Процессы роста, структура и межзеренное магнитное взаимодействие в электролитически осажденных пленках CoW

© В.Г. Шадров, К. О'Грэди*

Институт физики твердого тела и полупроводников Академии наук Белоруссии, 220072 Минск, Белоруссия *Университет г.Бангор, Бангор, Великобритания

(Поступила в Редакцию 20 июня 1996 г.)

Исследованы особенности формирования столбчатой микроструктуры и связанные с ними изменения магнитных характеристик электролитически осажденных пленок CoW с плоскостной магнитной анизотропией. Показано, что характер межзеренного магнитного взаимодействия определяется содержанием продуктов электродных реакций, их распределением в пленке, строением межкристаллитных границ, а также толщиной и текстурой пленок.

Высококоэрцитивные пленки сплавов на основе Со являются предметом интенсивного исследования, что обусловлено их широким применением в микроэлектронике, в том числе в качестве сред магнитной записи [1]. Несмотря на значительное количество работ, посвященных изучению магнитных свойств таких покрытий, вопросы перемагничивания межзеренного магнитного взаимодействия исследованы недостаточно, хотя они имеют большое практическое и научное значение. Так, имеются работы в области моделирования магнитного взаимодействия и прямого наблюдения с помощью электронной микроскопии [2,3], но исследований, в которых достаточно просто дается анализ характера взаимодействия в реальных пленках, мало. В частности, в [4] такой анализ для покрытий CoNiCr осуществляется на основе кривых остаточной намагниченности, а также с помощью развитого авторами метода δM -кривых. При этом исследования в данной области относятся преимущественно к пленкам, полученным вакуумными методами. Вопросы, касающиеся межзеренного взаимодействия и перемагничивания покрытий, полученных электрохимическими методами, практически вообще не исследованы, хотя такие покрытия могут оказаться весьма перспективными в ряде практических применений. К тому же в силу особенностей процессов формирования и структуры электрохимическим пленкам свойственны и особенности магнитного поведения.

1. Экспериментальная методика

В настоящей работе приводится исследование взаимосвязи процессов роста, структуры и межзеренного магнитного взаимодействия в электролитически осажденных пленках CoW со столбчатой микроструктурой, которые в зависимости от состава и условий осаждения могут обладать как плоскостной, так и перпендикулярной магнитной анизотропией [5,6]. Исследованные пленки, содержащие 12–17 wt.% вольфрама и имеющие плоскостную магнитную анизотропию, получались из сульфатно-хлоридного электролита [7] при кислотности pH = 6.6–6.7, плотности тока осаждения $D_k = 10 \text{ mA/cm}^2$ и температуре $T = 20-40^\circ$ С. Структура пленок изучена с помощью дифрактометра ДРОН-2, электронных микроскопов ЭМВ-100 ЛМ, Jeol-100 СХ, магнитные характеристики определялись с помощью силового магнетометра в полях до 120 kA/m. Для оценки магнитного взаимодействия в работе использовались кривые остаточной намагниченности и δM -кривые [4]. Данные для построения кривой остаточного намагничивания $I_r(H)$ получались последовательным намагничивания кривой остаточного размагничивания $I_d(H)$ — последовательным приложением образцу. Методика оценки магнитного взаимодействия с использованием кривых остаточной намагничивания лостроения кривой остаточного размагничивания $I_d(H)$ — последовательным приложением образцу. Методика оценки магнитного взаимодействия с использованием кривых остаточной намагниченности и уравнения

$$I_d(H) = 1 - 2I_r(H),$$
 (1)

которое справедливо для невзаимодействующих однодоменных частиц [8]. Соответственно нарушение данного соотношения (нарушение равенства $H_r = H'_r$, где H_r , H'_r определяются из $I_r(H)_r = (1/2)I_r(\infty)$, а $I_r(H'_r) = 0$) свидетельствует о наличии магнитного взаимодействия. δM -кривая получается модифицированием уравнения (1)

$$\delta M = I_d(H) - (1 - 2I_r(H)),$$
 (2)

В этом случае положительные значения δM трактуются как намагничивающее взаимодействие (обменное), а отрицательные — как размагничивающее (дипольное).

2. Результаты и их обсуждение

Как показали проведенные рентгенографические и электронно-микроскопические исследования [6,7] пленки СоW, полученные при принятых условиях осаждения, обладают текстурированной структурой на основе ГПУ кобальта и столбчатым типом кристаллитов, разделенных менее магнитными (по сравнению с ядром зерна) прослойками, содержащими гидроокись кобальта и имеющими повышенную концентрацию дефектов, водорода и других включений. Покрытия, полученные при



Рис. 1. Морфология поверхности пленок CoW с различной текстурой. *a*, *b* — [001], *c* — слабая [001], *d* — [100], *e* — [100]+[110]. *h* = 1 µm (образец № 1 — *h* = 800 Å). X30000.

температуре раствора 20° имеют кристаллиты цилиндрической формы (диаметром ~ 400-500 Å), ориентированные гранями (001) с наиболее насыщенными атомными связями. До толщин < 1 µm такие столбчатые кристаллиты растут независимо, при толщинах $\sim 1\,\mu{
m m}$ появляются агрегаты размером 0.7 µm, состоящие из мелких кристаллитов (рис. 1). Столбчатая структура формируется в осадках с текстурой [001], начиная с некоторых толщин (500-1000 Å), т.е. в области меньших толщин наблюдается переходной или начальный слой, характеризующийся хаотически ориентированными кристаллитами и отсутствием столбчатой структуры. Увеличение температуры электролита до 28° С приводит к ухудшению совершенства текстуры [001], а свыше 28° С — к переориентации оси С ГПУ решетки в плоскость пленки (табл. 1), кристаллиты приобретают форму стенок, общее количество включенных в осадок примесей с ростом температуры электролита уменьшается [7].

Характер изменения структуры пленок определяется в основном условиями электролиза. При pH > 5.0 в растворе образуются коллоидные взвеси гидроксидов, оксидов и основных солей Со и W, которые адсорбируются на катоде [7,9] и препятствуют когерентному срастанию и слиянию соседних островков на начальном этапе электрокристаллизации. Электрохимический процесс локализуется на поверхности кристаллитов-островков, отделенных один от другого границами с высоким содержанием посторонних включений, и как следствие такие кристаллиты растут в направлении нормали к плоскости катода в виде столбиков [6].

Адсорбционные коллоидные пленки, о наличии которых свидетельствуют электронограммы, полученные с поверхности осадка [6], являются и наиболее вероятной причиной образования агрегатов-столбиков в исследованных пленках, перераспределяясь по поверхности катода в процессе наращивания осадка. Как известно [7,8], часть адсорбированных примесей включается в осадок

Номер образца	$T^{\circ} C$	Текстура	<i>W</i> , wt.%	H_c , kA/m	H'_r , kA/m	<i>H_r</i> , kA/m
1	18	[001]	15	15	37	19
2	28	Слабая [001]	15	43	51	50
3	32	[100]	16	40	56	46
4	37	[100] + [110]	16	34	41	37
5	49	[110] + [101]	17	36	40	38

Таблица 1. Условия получения, текстура и магнитные характеристики пленок CoW ($n = 1 \, \mu m$)

CoW, а другая часть остается на поверхности, однако в зависимости от ориентации растущих кристаллитов эти процессы протекают по-разному. В частности, при текстуре [001], когда поверхность кристаллитов обращена к раствору гранями (001) с наиболее насыщенными атомными связями, вероятность включения примесей в кристаллит мала, и они вытесняются в межкристаллитную область преимущественно в перпендикулярном плоскости осадка направлении. Поскольку осадки Со и сплавов на его основе, получаемые при низких значениях плотности и pH ($D_k = 5-10 \text{ mA/cm}, \text{ pH} = 1-5$), имеют кристаллиты размером $\sim 1\,\mu{
m m}$, форма которых приближается к сфере [10], сформировавшуюся структуру осадков CoW можно считать результатом развития двух одновременно протекающих процессов: роста столбчатых кристаллитов ($\sim 500\,{
m \AA}$) и объединения их в агрегаты размером $\sim 1 \,\mu$ m.

Особенности процессов формирования кристаллитов находят свое отражение в изменении магнитных параметров пленок. Соответствующие значения коэрцитивной силы, измеренной в плоскости покрытий $H_{c_{\parallel}}$ и по нормали $H_{c_{\perp}}$, а также остаточные коэрцитивные параметры H'_r и H_r , полученные из кривых намагниченности (рис. 2), приведены в табл. 1, 2. Как видно из табл. 2 и рис. 3, всем образцам с текстурой [001], кроме образца № 1, соответствует дипольное взаимодействие ($H'_r > H_r$, $\delta M < 0$) вследствие магнитного разделения столбчатых зерен. Отсутствие столбчатой структуры в тонких слоях приводит к преобладанию обменного взаимодействия



Рис. 2. Кривые *I_r*(*H*) (*1*) и *I_d*(*H*) (*2*) образца № 1 (табл. 1).

 $(H'_r < H_r, \delta M > 0)$ для образца № 1. С ростом толщины величина дипольного взаимодействия (магнитное разделение) растет (до образца № 5) [4]. Образцу № 5 $(h = 1.2 \,\mu\text{m})$ (рис. 3) соответствует уменьшение величины дипольного взаимодействия по сравнению с образцом № 4, что на наш взгляд, обусловлено уменьшением концентрации примесей, включенных по границам столбчатых зерен вследствие их перераспределения при объединении исходных кристаллитов в агрегаты.

Наличие переходного слоя с преобладанием обменного взаимодействия находит свое отражение в появлении дополнительного низкокоэрцитивного пика на кривых $\delta M(H)$ (рис. 3), величина и положение которого зависят от соотношения толщин основного слоя со столбчатой микроструктурой и переходного слоя и их свойств. В частности, для покрытия образца № 1 (табл. 1) такой пик не наблюдается (кривая *1* на рис. 4), что может быть объяснено меньшей толщиной переходного слоя в этом случае, а также более совершенной текстурой [001] $(T = 18^{\circ} \text{ C})$ [7].

С данными о характере межзеренного магнитного взаимодействия, полученными из анализа кривых остаточной намагниченности, коррелируют зависимости коэрцитивной силы, измеренной по нормали и в плоскости покрытий. Как видно из табл. 2, до толщин $\sim 800 \text{ Å}$ зависимости $H_{c\perp}$ и $H_{c\parallel}$ от *h* изменяются синфазно, что предполагает перемагничивание таких покрытий преимущественно процессами смещения доменных границ [11], т.е. наличие обменного взаимодействия. В то же время



Рис. 3. Кривые δM пленок с текстурой [001] различной толщины h (Å): 1 - 400, 2 - 8000, 3 - 12000.

Номер образца	h, Å	<i>W</i> , wt.%	H'_r , kA/m	<i>H</i> _r , kA/m	$H_c \mathrm{kA/m}$	$H_c, kA/m$
1	400	13	66	67	51	72
2	800	13	90	87	76	118
3	2500	12	76	72	66	136
4	8000	13	67	63	60	138
5	12000	13	48	46	44	170

Таблица 2. Магнитные характеристики пленок CoW различной толщины ($T = 20^{\circ}$ C)

при больших толщинах увеличение $H_{c_{\perp}}$ сопровождается уменьшением $H_{c_{\parallel}}$, что может быть интерпретировано как преобладание процессов некогерентного вращения и отсутствия обменного взаимодействия.

Представляет интерес сопоставление процесса, происходящего при увеличении температуры электролита до 28° С, когда текстура [001] еще сохраняется (образец № 4 в табл. 1), с процессом, происходящим при увеличении толщины осадка с текстурой [001] свыше 1 μ m (образец № 5 в табл. 2). В обоих случаях наблюдается уменьшение степени магнитного разделения столбчатых зерен, однако в первом случае данное уменьшение обусловлено общим снижением количества включенных примесей с увеличением температуры электролита, что может привести к более заметному изменению магнитного взаимодействия ($\delta M \simeq 0$) (кривая 2 на рис. 4).

При других текстурах ([100], [110]) (табл. 1), когда поверхность растущих кристаллитов обращена к раствору гранями с менее насыщенными атомными связями, вероятность включения части примесей в объем кристаллитов возрастает, что наряду с некоторым увеличением содержания вольфрама может привести к уменьшению намагниченности вещества зерен и как следствие ослаблению их взаимодействия и проявляться как увеличение магнитного разделения зерен (кривая *3* на рис. 4). При этом полагается, что намагниченность вещества самих межзеренных границ меняется незначительно, поскольку уменьшение количества включенных в



Рис. 4. Кривые δM пленок CoW с различной текстурой ($h = 1 \,\mu$ m). I = [001], 2 = [слабая 001], 3 = [100], 4 = [100]+[110], 5 = [110]+[101].

границы примесей сопровождается уменьшением общего объема вещества границ вследствие роста размера зерен с увеличением температуры раствора [6]. Некоторое увеличение магнитного разделения зерен при повышении температуры до 37° С (кривая 4) можно объяснить также появлением кристаллитов с ориентацией [110], которые (по сравнению с ориентацией [100]) характеризуется более разориентированными границами [12]. В то же время уменьшение вклада дипольного взаимодействия при дальнейшем повышении температуры раствора до 49° С (кривая 5), по всей видимости, объясняется общим снижением количества примесей и появлением кристаллитов с ориентацией [101].

Работа частично выполнена за счет гранта NATO HT LG N 940656.

Список литературы

- [1] Y. Miura. J. Magn. Magn. Mater. **134**, 2–3, 209 (1994).
- [2] G.J. Hughes. Appl. Phys. 54, 3, 5306 (1983).
- [3] T. Chen. IEEE Trans. Magn. 17, 2, 1181 (1981).
- [4] P.O. Mayo, K. O'Grady, R.W. Chantrell, J.A. Cambridge, I.L. Sanders, T. Yogi, J.K. Howard, J. Mang. Mang. Mater. 95, 2, 109 (1991).
- [5] U. Admon, M.P. Dariel, U. Grunbaum, J.C. Lodder. J. Appl. Phys. 66, 1, 316 (1989).
- [6] В.Г. Шадров, А.В. Болтушкин, Т.А. Точицкий. Изв. АН СССР. Металлы, 4, 61 (1990).
- [7] В.Г. Шадров, Р.И. Тагиров, А.В. Болтушкин. ФММ 11, 82 (1992).
- [8] E.P. Wohlfarth. J. Appl. Phys. 29, 3, 595 (1958).
- [9] В.А. Парфенов, В.С. Рачинскас. Тр. АН ЛитССР. Сер. Б, 4, 27 (1988).
- [10] S. Nakahara, S. Mahajan. J. Electrochem. Soc. 127, 2, 283 (1980).
- [11] R. Sard, C.D. Schwartz, R. Weil. J. Electrochem. Soc. 113, 5, 424 (1966).
- [12] А.В. Болтушкин, Т.А. Точицкий, В.М. Федосюк. Изв. АН БССР. Сер. физ.-мат. наук, 4, 64 (1989).